

導入講演

「ファウンダリーを支える最先端装置技術と アカデミックの関わり」

執行役員 技術戦略担当 奥野 泰利

技術講演

「次世代半導体を実現する最先端ウェット洗浄技術」

洗浄開発統轄部 洗浄技術開発部 田中 孝佳

理工学域セミナー・TREMS共催

12月8日(水)

Zoom開催 15:30～16:30

ZOOM ミーティングID: 895 7371 8645
パスコード: 315361



奥野 泰利
執行役員
技術戦略担当



田中 孝佳
洗浄開発統轄部
洗浄技術開発部

技術講演内容

半導体デバイスの微細化に伴い、ウェット洗浄はシリコンウェハから異物を除去するだけに留まらず、次世代半導体の実現に欠かせない技術へと進化してきた。本講演では、皆さんに洗浄に興味を持って頂けるよう、化学反応や物理モデルを使い基礎から最先端までを解説する。

